

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成17年6月23日(2005.6.23)

【公開番号】特開2002-212786(P2002-212786A)

【公開日】平成14年7月31日(2002.7.31)

【出願番号】特願2001-9537(P2001-9537)

【国際特許分類第7版】

C 2 5 D 7/12

C 2 5 D 3/38

C 2 5 D 17/06

C 2 5 D 17/08

C 2 5 D 19/00

H 0 1 L 21/288

【F I】

C 2 5 D 7/12

C 2 5 D 3/38

C 2 5 D 17/06 C

C 2 5 D 17/06 B

C 2 5 D 17/08 M

C 2 5 D 19/00 B

H 0 1 L 21/288 E

【手続補正書】

【提出日】平成16年10月6日(2004.10.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を保持するヘッド部と、前記基板に対して所定の処理を行う複数の基板処理部とを備え、

前記ヘッド部は、基板を保持したまま、前記基板処理部間を移動して各基板処理部において前記所定の処理を行うことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

前記複数の基板処理部のうちの少なくとも1つは、基板に対してめっき処理を行うめっき処理部であることを特徴とする請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項3】

前記複数の基板処理部のうちの少なくとも1つは、基板を洗浄する洗浄部であることを特徴とする請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項4】

前記洗浄部は、洗浄後の基板を乾燥するエアプロアを備えたことを特徴とする請求項3に記載の基板処理装置。

【請求項5】

前記ヘッド部は、保持した基板を傾動可能に支持する傾動機構を備えたことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項6】

前記ヘッド部は、該ヘッド部を傾動させることによって、保持した基板を水平面に対し

傾斜させた状態で液面に接触させる傾動機構を備えたことを特徴とする請求項1乃至4の  
いずれか一項に記載の基板処理装置。